

## EV GROUP Advances Leadership in Optical Lithography With Next-generation EVG150 Resist Processing Platform – November 10, 2022



EV Group透過次世代EVG150光阻製程平台擴大在光學微影領域的...

台灣產經新聞網 2022/11/10 00:00

字級: A- A A+



經重新設計的200奈米平台提升模組數量以達到更高的製程產出，

透過取巧改善降低設備的佔地面積，同時維持前一代平台引領業界的功能

台北，2022年11月10日 — 微機電系統 (MEMS)、奈米科技與半導體市場的最高級合置微影技術設備領導廠商EV Group (EVG)，今天宣布發表次世代200奈米版本的EVG®150自動化光阻製程系統，強化該公司的光學微影解決方案產品組合。重新設計的EVG150平台包括先進功能與強化項目，與前一代平台相比可提供更高的製程產出 (最高高出80%)、通用性，以及更小的設備佔地面積 (減少近50%)。EVG150在通用的平台上提供可靠且高品質的塗佈與顯影製程。可支援各種裝置與應用，包括先進封裝、微機電系統、無線射頻 (RF)、3D感測、功率元件以及光子元件。EVG150極高的製程產出、彈性與再現性，能支援大規模量產與工業開發所需的靈敏度需求。

電子控制系統 (EBS) 產業的頂尖研究中心Silicon Austria Labs是第一個採用次世代EVG150系統的客戶。Silicon Austria Labs微系統研究部門負責人Mohssen Moridi博士表示：「早在工業4.0、物聯網、自動駕駛、虛實整合系統 (CPS)、人工智慧、智慧城市、智慧能源與智慧醫療等市場，我們就透過與引領業界的製造商共同研究，開發出奠定上述應用基礎的關鍵技術。EVG的次世代EVG150光阻製程系統的高產彈性，為我們客戶的全新製程與產品的大規模導入打好基礎，並推動EBS的創新。」

通用平台提供前所未有的彈性

為200奈米基板設計的次世代EVG150保有前一代平台引領業界的功能，包括具有全自動化功能的可客製化的旋轉與調整式塗佈、顯影、烘爐與冷卻模組；EVG專有的OmniSpray®技術，可因應各種形貌的成形塗佈；精密且經過經驗的機械化處理，具備尖端執行器可確保持續的高製程產出；以及晶圓邊緣、弓形、圓曲及薄化晶圓的處理。

次世代EVG150 200奈米平台的全新功能包括：

幾多達四個渾式轉運模組的區隔，以及高達20個烘箱/冷卻單元，可以同時處理更多的晶圓。獨立的光阻塗佈腔體使後道間完全隔離，幾乎完全消除後道間交叉污染。經過進一步重新設計，可從設備外部更輕鬆地檢測不同的腔體，獲得極小的停機時間，且全進行設備保養時也可持續操作設備。系統內部的腔體重新布局，以便更迅速及機械化處理來進行保養。具有影像功能的預對準系統，可以隨時進行重新置中進而加速製程。整合系統內部的光阻與化學藥液管理，可以減少儲存化學藥液的外部設備面積，並降低設備佔地面積。將使用者介面整合於系統內，可以進一步降低設備的佔地面積。

EV Group企業技術總監Thomas Glinsner博士表示：「光阻製程與圓形化是半導體製造中反覆進行最多次的製程步驟，EVG已經針對這些製程累積了多年的經驗，包括光學微影、旋轉與顯影式塗佈，以滿足最嚴苛的客戶需求，我們將這些經驗融入到次世代的EVG150系統中，這套系統是全面性的重新設計，可在通用平台上提供更具性的製程量比與顯著成本效益，提供無與倫比的彈性，以滿足最靈活的光阻製程需求。」

#### 產品供應時程

EVG已經開始接受各界對次世代EVG150自動化光阻製程系統的訂單，並在公司總部提供產品展示。更多相關資訊請瀏覽：<https://www.evgroup.com/products/lithography/resist-processing-systems/evg150/>。

#### 關於EV Group (EVG)

EVG是全球半導體、微機型、化合物半導體、電源元件和奈米科技應用的晶圓製程解決方案領導廠商，主要業務包括晶圓鍍金、晶圓薄化、微影/奈米壓印微影技術 (NIL) 和檢測設備，以及光阻塗佈機、顯影機、晶圓清洗和檢測設備。EVG成立於1980年，藉由一個完善的全球服務團隊為全球的客戶和合作夥伴提供服務。更多相關資訊請參考公司網站：[www.EVGroup.com](http://www.EVGroup.com)。

<https://m.match.net.tw/pc/news/finance/20221110/6919054>